

Symbol	Typ	Titel
G	Sektion	Sektion G – Physik
G03	Klasse	Fotografie; Kinematografie; vergleichbare Techniken unter Verwendung von nicht optischen Wellen; Elektrografie; Holografie [4]
G03F	Unterklasse	Fotomechanische Herstellung strukturierter oder gemusterter Oberflächen, z.B. zum Drucken, zum Herstellen von Halbleiterbauelementen; Materialien dafür; Kopiervorlagen dafür; Vorrichtungen besonders ausgebildet dafür (Lichtsetzmaschinen B41B; lichtempfindliche Materialien oder fotografische Verfahren G03C; Elektrografie, lichtempfindliche Schichten oder Verfahren dafür G03G)
G03F 1/00	Hauptgruppe	Kopiervorlagen für die fotomechanische Herstellung von strukturierten oder gemusterten Oberflächen, z.B. Masken, Fotomasken oder Zielmarken; zugehörige Maskenrohlinge oder Pellicles; besonders hierfür ausgebildete Behälter; Herstellung derselben [1, 3, 2006.01, 2012.01]
G03F 1/20	1-Punkt Untergruppe	. Masken oder Maskenrohlinge zur Abbildung mittels Strahlung geladener Teilchen, z.B. mittels Elektronenstrahlung; Herstellung derselben [2012.01]
G03F 1/22	1-Punkt Untergruppe	. Masken oder Maskenrohlinge zur Abbildung mittels Strahlung von 100 nm oder kürzerer Wellenlänge, z.B. Röntgen-Masken, EUV-Masken; Herstellung derselben [2012.01]
G03F 1/24	2-Punkt Untergruppe	. . Reflexionsmasken; Herstellung derselben [2012.01]
G03F 1/26	1-Punkt Untergruppe	. Phasenverschiebungsmasken (PSM); PSM-Rohlinge; Herstellung derselben [2012.01]
G03F 1/28	2-Punkt Untergruppe	. . mit drei oder mehr unterschiedlichen Phasen auf derselben PSM; Herstellung derselben [2012.01]
G03F 1/29	2-Punkt Untergruppe	. . Rim-PSM oder Outrigger-PSM; Herstellung derselben [2012.01]
G03F 1/30	2-Punkt Untergruppe	. . Alternierende PSM, z.B. Levenson-Shibuya-PSM; Herstellung derselben [2012.01]
G03F 1/32	2-Punkt Untergruppe	. . Abschwächende PSM (attenuating PSM, att PSM), z.B. PSM mit einem halbdurchlässigen Phasenverschiebungsbereich, Halbton-PSM; Herstellung derselben [2012.01]
G03F 1/34	2-Punkt Untergruppe	. . Phasenkanten-PSM, z.B. chromlose PSM; Herstellung derselben [2012.01]
G03F 1/36	1-Punkt Untergruppe	. Masken mit Strukturen zur Proximity Correction; Herstellung derselben, z.B. Entwurfsprozesse (Optical Proximity Correction [OPC]) [2012.01]
G03F 1/38	1-Punkt Untergruppe	. Masken mit Hilfsstrukturen, z.B. speziellen Beschichtungen oder Ausrichtungsmarken oder Prüfmarken; Herstellung derselben [2012.01]
G03F 1/40	2-Punkt Untergruppe	. . Besonderheiten, die auf die elektrostatische Entladung [ESD] bezogen sind, z.B. antistatische Beschichtungen oder ein elektrisch leitfähiger Metallmantel, der das Äußere des Maskensubstrates umschließt [2012.01]
G03F 1/42	2-Punkt Untergruppe	. . Strukturen für Ausrichtung, Registrierung oder Identifizierung der Maske, z.B. Ausrichtungsmarken auf den Maskensubstraten [2012.01]
G03F 1/44	2-Punkt Untergruppe	. . Prüfstrukturen oder Messstrukturen, z.B. Gitterstrukturen, Strukturen zur Fokusüberwachung, Sägezahnskalen oder Kerbskalen [2012.01]
G03F 1/46	2-Punkt Untergruppe	. . Antireflexbeschichtungen [2012.01]
G03F 1/48	2-Punkt Untergruppe	. . Schutzbeschichtungen [2012.01]
G03F 1/50	1-Punkt Untergruppe	. Maskenrohlinge, die nicht durch die Gruppen G03F 1/20-G03F 1/26 abgedeckt werden; Herstellung derselben [2012.01]
G03F 1/52	1-Punkt Untergruppe	. Reflektoren [2012.01]
G03F 1/54	1-Punkt Untergruppe	. Absorber, z.B. opakes Material [2012.01]

Symbol	Typ	Titel
G03F 1/56	2-Punkt Untergruppe	. . Organische Absorber, z.B. Fotolack [2012.01]
G03F 1/58	2-Punkt Untergruppe	. . mit zwei oder mehr verschiedenen Absorberschichten, z.B. Mehrlagenabsorber [2012.01]
G03F 1/60	1-Punkt Untergruppe	. Substrate [2012.01]
G03F 1/62	1-Punkt Untergruppe	. Pellikel oder Pellikelanordnungen, z.B. Anordnung eines Pellikels auf einem Stützrahmen; Herstellung derselben [2012.01]
G03F 1/64	2-Punkt Untergruppe	. . charakterisiert durch die Rahmen, z.B. deren Struktur oder Material [2012.01]
G03F 1/66	1-Punkt Untergruppe	. Behälter, besonders ausgebildet für Masken, Maskenrohlinge oder Pellikel; Herstellung derselben [2012.01]
G03F 1/68	1-Punkt Untergruppe	. Herstellungsprozesse, die nicht durch die Gruppen G03F 1/20-G03F 1/50 abgedeckt sind [2012.01]
G03F 1/70	2-Punkt Untergruppe	. . Anpassung des grundlegenden Entwurfs oder des Aufbaus der Masken an die Anforderungen des lithografischen Prozesses, z.B. Zweischrittkorrektur von Maskenmustern für Abbildungsverfahren [2012.01]
G03F 1/72	2-Punkt Untergruppe	. . Reparatur oder Korrektur von Maskenfehlern [2012.01]
G03F 1/74	3-Punkt Untergruppe	. . . mittels Strahlung geladener Teilchen, z.B. fokussierter Ionenstrahl [2012.01]
G03F 1/76	2-Punkt Untergruppe	. . Erstellen von Mustern auf Masken durch Abbildungsverfahren [2012.01]
G03F 1/78	3-Punkt Untergruppe	. . . mittels Strahlung geladener Teilchen, z.B. Elektronenstrahlung [2012.01]
G03F 1/80	2-Punkt Untergruppe	. . Ätzen [2012.01]
G03F 1/82	2-Punkt Untergruppe	. . Hilfsprozesse, z.B. Reinigen [2012.01]
G03F 1/84	3-Punkt Untergruppe	. . . Überprüfen [2012.01]
G03F 1/86	4-Punkt Untergruppe mittels Strahlung geladener Teilchen [2012.01]
G03F 1/88	1-Punkt Untergruppe	. hergestellt mittels fotografischer Arbeitsgänge, um Kopiervorlagen zu bilden, die ein Relief simulieren [2012.01]
G03F 1/90	1-Punkt Untergruppe	. hergestellt durch Montageverfahren [2012.01]
G03F 1/92	1-Punkt Untergruppe	. hergestellt ausgehend von Druckflächen [2012.01]
G03F 3/00	Hauptgruppe	Farbtrennung; Berichtigung des Farbwertes (fotografische Kopierapparate allgemein G03B) [1, 2006.01]
G03F 3/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Retuschieren [1, 2006.01]
G03F 3/04	1-Punkt Untergruppe	. durch fotografische Verfahren [1, 2006.01]
G03F 3/06	2-Punkt Untergruppe	. . durch Maskieren [1, 2006.01]
G03F 3/08	1-Punkt Untergruppe	. durch fotoelektrische Mittel [1, 2006.01]
G03F 3/10	1-Punkt Untergruppe	. Prüfen des Farbwertes oder Tonwertes der Auszugsnegative oder Auszugspositive [1, 2006.01]
G03F 5/00	Hauptgruppe	Rasterverfahren; Raster dafür [1, 2006.01]
G03F 5/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Projektion (Kameras G03B) [1, 2006.01]
G03F 5/04	2-Punkt Untergruppe	. . durch Wechsel der Rasterwirkung [1, 2006.01]
G03F 5/06	2-Punkt Untergruppe	. . durch Wechsel der Blendenwirkung [1, 2006.01]
G03F 5/08	2-Punkt Untergruppe	. . durch Linienraster [1, 2006.01]
G03F 5/10	2-Punkt Untergruppe	. . durch Kreuzlinienraster [1, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
G03F 5/12	2-Punkt Untergruppe	. . durch andere, z.B. Kornraster [1, 2006.01]
G03F 5/14	1-Punkt Untergruppe	. durch Kontaktverfahren [1, 2006.01]
G03F 5/16	2-Punkt Untergruppe	. . durch graue Halbtone [1, 2006.01]
G03F 5/18	2-Punkt Untergruppe	. . durch Farb-Halbtone [1, 2006.01]
G03F 5/20	1-Punkt Untergruppe	. durch Raster für Tiefdruck [1, 2006.01]
G03F 5/22	1-Punkt Untergruppe	. durch Kombination verschiedener Raster; Beseitigung von Moire. [1, 2006.01]
G03F 5/24	1-Punkt Untergruppe	. durch mehrfache Belichtung, z.B. Kombination von Strichraster und Linienraster [1, 2006.01]
G03F 7/00	Hauptgruppe	Fotomechanische, z.B. fotolithografische Herstellung von strukturierten oder gemusterten Oberflächen, z.B. Druckflächen; Materialien dafür, z.B. mit Fotolacken [Resists]; Vorrichtungen besonders ausgebildet dafür (Fotolackstrukturen für spezielle Herstellungsverfahren siehe die entsprechenden Stellen z.B. B44C, H10P 76/00, H05K) [1, 3, 5, 2006.01]
G03F 7/004	1-Punkt Untergruppe	. Lichtempfindliche Materialien (G03F 7/12 , G03F 7/14 haben Vorrang) [5, 2006.01]
G03F 7/008	2-Punkt Untergruppe	. . Azide (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]
G03F 7/012	3-Punkt Untergruppe	. . . Makromolekulare Azide; makromolekulare Zusätze, z.B. Bindemittel [5, 2006.01]
G03F 7/016	2-Punkt Untergruppe	. . Diazoniumsalze oder Diazoniumverbindungen (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]
G03F 7/021	3-Punkt Untergruppe	. . . Makromolekulare Diazoniumverbindungen; makromolekulare Zusätze, z.B. Bindemittel [5, 2006.01]
G03F 7/022	2-Punkt Untergruppe	. . Chinondiazide (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]
G03F 7/023	3-Punkt Untergruppe	. . . Makromolekulare Chinondiazide; makromolekulare Zusätze, z.B. Bindemittel [5, 2006.01]
G03F 7/025	2-Punkt Untergruppe	. . Nicht-makromolekulare fotopolymerisierbare Verbindungen mit Kohlenstoff-Kohlenstoff-Dreifachbindung, z.B. Acetylenverbindungen (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]
G03F 7/027	2-Punkt Untergruppe	. . Nicht-makromolekulare fotopolymerisierbare Verbindungen mit Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung, z.B. Ethylenverbindungen (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]
G03F 7/028	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Zusätzen zum Erhöhen der Lichtempfindlichkeit, z.B. Fotoinitiatoren [5, 2006.01]
G03F 7/029	4-Punkt Untergruppe Anorganische Verbindungen; Oniumverbindungen; organische Verbindungen mit anderen Heteroatomen als Sauerstoff, Stickstoff oder Schwefel [5, 2006.01]
G03F 7/031	4-Punkt Untergruppe Organische Verbindungen soweit nicht von G03F 7/029 umfasst [5, 2006.01]
G03F 7/032	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Bindemitteln [5, 2006.01]
G03F 7/033	4-Punkt Untergruppe mit Polymeren als Bindemittel, erhalten durch Reaktionen, an denen nur ungesättigte Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen beteiligt sind, z.B. Vinylpolymere [5, 2006.01]
G03F 7/035	4-Punkt Untergruppe mit Polyurethanen als Bindemittel [5, 2006.01]
G03F 7/037	4-Punkt Untergruppe mit Polyamiden oder Polyimiden als Bindemittel [5, 2006.01]
G03F 7/038	2-Punkt Untergruppe	. . makromolekulare Verbindungen, die unlöslich oder unterschiedlich benetzbar gemacht werden (G03F 7/075 hat Vorrang; makromolekulare Azide G03F 7/012; makromolekulare Diazoniumverbindungen G03F 7/021) [5, 2006.01]
G03F 7/039	2-Punkt Untergruppe	. . Makromolekulare fotodepolymerisierbare Verbindungen, z.B. positiv arbeitende elektronenempfindliche Fotolacke [Resists] (G03F 7/075 hat Vorrang; makromolekulare Chinondiazide G03F 7/023) [5, 2006.01]
G03F 7/04	2-Punkt Untergruppe	. . Chromate (G03F 7/075 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
G03F 7/06	2-Punkt Untergruppe	. . Silbersalze (G03F 7/075 hat Vorrang) [1, 5, 2006.01]
G03F 7/07	3-Punkt Untergruppe	. . . für Diffusionsübertragung [5, 2006.01]
G03F 7/075	2-Punkt Untergruppe	. . Siliciumhaltige Verbindungen [5, 2006.01]
G03F 7/085	2-Punkt Untergruppe	. . Lichtempfindliche Zusammensetzungen, gekennzeichnet durch haftungsverbessernde nicht-makromolekulare Zusätze (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]
G03F 7/09	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch Einzelheiten des Aufbaus, z.B. Schichtträger, Hilfsschichten (Schichtträger für Druckformen allgemein B41N) [5, 2006.01]
G03F 7/095	3-Punkt Untergruppe	. . . mit mehr als einer lichtempfindlichen Schicht (G03F 7/075 hat Vorrang) [5, 2006.01]
G03F 7/105	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Substanzen, z.B. Indikatoren, zum Sichtbarmachen der Strukturen [5, 2006.01]
G03F 7/11	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Deckschichten oder Zwischenschichten, z.B. Trennschichten [5, 2006.01]
G03F 7/115	3-Punkt Untergruppe	. . . mit Schichtträgern oder Schichten zum Erhalt eines Rastereffektes oder zum Verbessern des Kontaktes beim Kontaktkopieren in einem Vakuumrahmen [5, 2006.01]
G03F 7/12	1-Punkt Untergruppe	. Herstellen von Siebdruckformen oder ähnlichen Druckformen, z.B. Schablonen [1, 2006.01]
G03F 7/14	1-Punkt Untergruppe	. Herstellen von Lichtdruckformen [1, 2006.01]
G03F 7/16	1-Punkt Untergruppe	. Beschichtungsverfahren; Vorrichtungen dafür (Aufbringen von Beschichtungen auf Trägermaterialien allgemein B05; Aufbringen lichtempfindlicher Zusammensetzungen auf den Schichtträger für fotografische Zwecke G03C 1/74) [1, 2006.01]
G03F 7/18	2-Punkt Untergruppe	. . Beschichten gekrümmter Oberflächen [1, 2006.01]
G03F 7/20	1-Punkt Untergruppe	. Belichten; Vorrichtungen dafür (fotografische Kopiergeräte G03B 27/00) [1, 4, 2006.01]
G03F 7/207	2-Punkt Untergruppe	. . Vorrichtungen zum Scharfeinstellen, z.B. selbsttätig (Kombinationen von Positionieren und Scharfeinstellen G03F 9/02; Systeme zum automatischen Erzeugen von Scharfeinstellungssignalen allgemein G02B 7/28; Vorrichtungen zum selbsttätigen Scharfeinstellen von Projektions-Kopier- Geräten G03B 27/34) [4, 2006.01]
G03F 7/213	2-Punkt Untergruppe	. . gleichzeitiges Belichten von verschiedenen Stellen derselben Oberfläche mit demselben Lichtmuster (G03F 7/207 hat Vorrang) [4, 2006.01]
G03F 7/22	2-Punkt Untergruppe	. . aufeinanderfolgendes Belichten von verschiedenen Stellen derselben Oberfläche mit demselben Lichtmuster (G03F 7/207 hat Vorrang) [1, 4, 2006.01]
G03F 7/23	3-Punkt Untergruppe	. . . selbsttätige Vorrichtungen dafür [4, 2006.01]
G03F 7/24	2-Punkt Untergruppe	. . Gekrümmte Oberflächen [1, 2006.01]
G03F 7/26	1-Punkt Untergruppe	. Verarbeitung von lichtempfindlichen Materialien; Vorrichtungen dafür (G03F 7/12-G03F 7/24 haben Vorrang) [3, 5, 2006.01]
G03F 7/28	2-Punkt Untergruppe	. . zur Herstellung von Pulverbildern (G03F 3/10 hat Vorrang) [5, 2006.01]
G03F 7/30	2-Punkt Untergruppe	. . Bildmäßiges Entfernen mit Hilfe von Flüssigkeiten [5, 2006.01]
G03F 7/32	3-Punkt Untergruppe	. . . Flüssigkeitszusammensetzungen dafür, z.B. Entwickler [5, 2006.01]
G03F 7/34	2-Punkt Untergruppe	. . Bildmäßiges Entfernen durch selektive Übertragung, z.B. Abziehverfahren [5, 2006.01]
G03F 7/36	2-Punkt Untergruppe	. . Bildmäßiges Entfernen, soweit nicht von den Gruppen G03F 7/30-G03F 7/34 umfasst, z.B. mittels eines Gasstromes, Plasmas [5, 2006.01]
G03F 7/38	2-Punkt Untergruppe	. . Vorbehandlung vor dem bildmäßigen Entfernen, z.B. Vorbacken [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
G03F 7/40	2-Punkt Untergruppe	. . Nachbehandlung nach dem bildmäßigen Entfernen, z.B. Backen [5, 2006.01]
G03F 7/42	2-Punkt Untergruppe	. . Abziehen oder Agenzien dafür [5, 2006.01]
G03F 9/00	Hauptgruppe	Registergerechtes oder sonstiges Positionieren von Kopiervorlagen, Masken, Rastern, fotografischen Folien oder strukturierten oder gemusterten Oberflächen, z.B. selbsttätig (G03F 7/22 hat Vorrang; Herstellen von Kopiervorlagen G03F 1/00; bei fotografischen Kopiergeräten zur Herstellung von Kopien G03B 27/00) [1, 4, 2006.01]
G03F 9/02	1-Punkt Untergruppe	. kombiniert mit Mitteln zum automatischen Scharfeinstellen (automatisches Scharfeinstellen allgemein G02B 7/09; Systeme zum automatischen Erzeugen von Scharfeinstellsignalen G02B 7/28) [4, 2006.01]